

4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム
・慶大 ・早大 ・東工大 ・東大

NANOBICクリーンルーム 装置講習会のご案内 ～クラスタ型コータディベロッパ～

4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムは大学・地方自治体・産業界が連携する新しい形の研究教育拠点です。新川崎・創造のもり地区において、ナノ・マイクロスケールの微細加工、評価・解析の各設備を整備し、産業界への開放利用も推進しています。本講習会では、本研究拠点におけるクラスタ型コータディベロッパの原理および活用方法を紹介するとともに、今後のNANOBICご利用のきっかけとしていただく機会といたしました。

装置

ズース・マイクロテック社製 クラスタ型コータディベロッパ

場所

新川崎 創造のもり
NANOBICクリーンルーム及びKBIC小会議室

開催日

平成28年11月16日(水) 13:00～17:00

定員

15名(申し込み順とさせていただきます)
参加申込はmatsugaki@newkast.or.jp(松垣)までお願いします

主な用途・特徴

- ・フォトレジストのスピコート、スプレーコート、現像、バーク、ベーパープライムを全自動でプロセス可能
- ・高い均一性、再現性
- ・25～50枚までのウエハーを連続処理可能

主な機能とオプション

対応基板サイズ：2、3、4インチ、異形基板にも一部対応可能
ウエハーハンドリング：全自動、レシピ作成可能
シリンジを用いた希少レジストの塗布にも対応
バイク可能温度範囲：60～250℃
スピコート均一性：±1.0%以内(膜厚10 μmにおいて)



クラスタ型コータディベロッパ